

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-142045

(43) Date of publication of application: 31.05.1990

(51)Int.CI.

H01J 37/147 H01J 37/05

(21)Application number: 63-294527

(71)Applicant : HITACHI LTD

(22)Date of filing:

(72)Inventor: KURODA KATSUHIRO

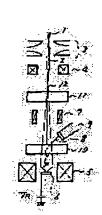
(54) SCAN TYPE ELECTRON MICROSCOPE AND SIMILAR DEVICE THEREOF

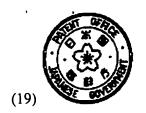
(57)Abstract:

PURPOSE: To achieve a high resolution in a low acceleration range, and obtain a high detection sensitivity for secondary electrons by using a filter of an in-lens type where a sample is disposed inside a lens, and of an E × B type which decelerates a primary electron beam by applying a negative voltage to the sample while crossing an electric field with a magnetic field.

CONSTITUTION: An electron beam 2 generated from an electron gun 1 is throttled through an acceleration lens 3, a capacitor lens 4, and an objective lens 5, for example, to be thin and radiated on a sample 6. The electron beam 2 is scanned on the sample 6 two-dimensionally by a deflector 7, and a secondary electron 8 generated from the sample 6 is detected by a secondary electron detector 9 to be an image signal. A negative voltage VR is then applied to the sample 6 for decelerating the electron beam 2, and the generated secondary electron 8 is accelerated by the decelerating voltage VR inversely, so it cannot be deflected to the detector 9 sufficiently only by the electric field of the detector 9. A filter 10 of a so-called E × B type where an electric field is made to cross with a magnetic field is disposed between the objective lens 5 and the detector 9 to eliminate the effects on the

route of the electron beam 2. A high resolution and a high detection sensitivity for secondary charged particles can thus be obtained in a low acceleration range.





(11) Publication number:

02142045 A

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: **63294527**

(51) Intl. Cl.: **H01J 37/147** H01J 37/05

(22) Application date: 24.11.88

(30) Priority:

(43) Date of application

31.05.90

publication:

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: HITACHI LTD

(72) Inventor: KURODA KATSUHIRO

(74) Representative:

(54) SCAN TYPE ELECTRON MICROSCOPE AND SIMILAR DEVICE THEREOF

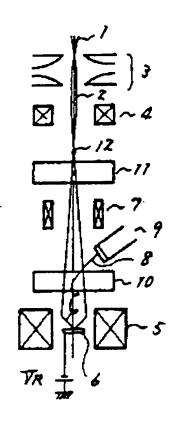
(57) Abstract:

PURPOSE: To achieve a high resolution in a low acceleration range, and obtain a high detection sensitivity for secondary electrons by using a filter of an in-lens type where a sample is disposed inside a lens, and of an E×B type which decelerates a primary electron beam by applying a negative voltage to the sample while crossing an electric field with a magnetic field.

CONSTITUTION: An electron beam 2 generated from an electron gun 1 is throttled through an acceleration lens 3, a capacitor lens 4, and an objective lens 5, for example, to be thin and radiated on a sample 6. The electron beam 2 is scanned on the sample 6 two-dimensionally by a deflector 7, and a secondary electron 8 generated from the sample 6 is detected by a secondary electron detector 9 to be an image signal. A negative voltage VR is then applied to the sample 6 for

decelerating the electron beam 2, the generated secondary electron 8 is accelerated by the decelerating voltage VR inversely, so it cannot be deflected to the detector 9 sufficiently only by the electric field of the detector 9. A filter 10 of a so-called E×B type where an electric field is made to cross with a magnetic field is disposed between the objective lens 5 and the detector 9 to eliminate the effects on the route of the electron beam 2. A high resolution and a high detection sensitivity for secondary charged particles can thus be obtained in a low acceleration range.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio



化物物 经分类的 医克里特氏性结肠管 化氯化钠 化二氯甲基酚 化氯甲基酚甲基酚甲基酚酚 化克克雷斯基甲基克斯基阿尔克斯基克斯

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-142045

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)5月31日

H 01 J 37/147 37/05 B 7013-5C 7013-5C ₩ - 版 2 + (1990) 3 / 31 C

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全4頁)

国発明の名称 走査形電子顕微鏡及びその類似装置

②特 頭 昭63-294527

@出 頭 昭63(1988)11月24日

@発明者 黒田

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

勿出 願 人 株式

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

仰代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

用 抽 書

1、発明の名称

走査形電子頭微鏡及びその類似装置

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 電子鉄と、該電子源からでた電子線を細く校って試料に照射するレンズ手段、該電子線を該 試料上で二次元的に走査する走査手段、該試料からでなる二次電子を検出する検出手段と からでなる装置において、該試料には負の配ならびに らなる装置において、該試料には負の配ならびに 該検出手段に対して該電子源側にそれでした。 (E)と選界(B)を直行させたいわゆるを B形フィルタを配置したことを特徴とする走査 形電子顕微鏡及びその類似装置。
 - 2. 荷電粒子減と、該荷電粒子減からでた荷電粒子線を組く絞って試料に照射するレンズ手段、 該荷電粒子線を該試料上で二次元的に走査する 走査手段、該試料からでてくる二次荷電粒子を 検出する検出手段とからなる装置において、該 試料には上記荷電粒子が負の荷電粒子であると

き負の電圧を、上記荷電粒子が正の荷電粒子であるとき正の電圧を印加し、かつ該試料と鉄検出手段との間ならびに該検出手段に対して該積電粒子源側にそれぞれ電界(E)と磁界(B)を直行させたいわゆるE×B形フィルタを配置したことを特徴とする走査形荷電粒子顕微気及びその類似装置。

- 3. 試料配置部が、レンズの内部に配設されたことを特徴とする請求項第1項記載の走流形荷電 粒子顕微版及びその類似装置。
- 4. 上記E×B形フィルタの電界の方向を、検出 手段の方向と一致させたことを特徴とする請求 項第1項もしくは第2項のいずれかに記載の定 室形荷買粒子隣徴鏡及びその類似装置。
- 発明の詳細な説明
 [遊案上の利用分野]

本税明は、走査形荷電粒子頭做魚及びその類似 装置に係り、特に低加速領域において高分解能で かつ二次電子の高検出効率に好過な荷電粒子光学 系に関する。

【従来の技術】

走変形電子駅微気の分解館を向上させるために、 特頭昭60-136004に記載されているよう な光学系が用いられている。すなわち、輝度が高 く、エネルギ幅の小さな電界放射形(FE)電子 銃と、レンズの内部に試料を配置して収差を振力 小さくしたインレンズ形対物レンズとを組合わせ たものである。このような光学系においても低加 ・速倒域においては分解館は低下する。

一方、色収差を低減するために、特公昭63-34588に記載されているような光学系が提案されている。

この光学系は、電子線が試料を照射する直前まで高加速電圧とし、試料照射時に減速して低加速電圧化するものである。この場合、レンズ通過時の電子線のエネルギが高いので、レンズ収差を小さくできる。すなわち、高分解能化が図れる。

以上の観点から、低加速領域で従来以上の高分 解能を得るためには、上記両者の光学系を組合せ れば可能となる。すなわち、試料はレンズの内部

ればよいことはすでに述べた。この光学系で、二次電子の高検出効率化を図るために、一次電子線の減速電界で加速された二次電子をレンズ通過後検出器の方に傾向させればよい。ただこの場合、一次電子線には影響しないように二次電子のみを検出器の方に傾向する必要がある。そのためには、電界(E)と磁界(B)とを直行させたいわゆる

[作用]

まず、試料照射の直前に電子線の波速を行えば、 低加速電圧でも高分解館が得られることは従来技 術からも分かる。

E×B形のフィルタを用いれば可能となる。

一方、二次電子検出に関しては、E×B形のフィルタを試料と検出器との間に用いているので、一次電子線を直進するようにしてやれば、エネルギの異なる二次電子は自然に偏向されることになる。すなわち、第5回に示すように電子線2の加速電圧V。にたいして、次式を満足するようにEとBを印加すれば、電子線2の軌道に影響を与えない。

に配置し、この試料に負の電圧を印加して減速す。 ればよい。

ただ、この 合問題となるのは二次で子の検出 である。試料がレンズの外部にある従来の場合に は、特公昭63-34588に示されているされている。 に、一次電子線の減速電界で二次電子が加速され るまでに二次電子検出器の電界で二次で子を するように構成すればよかった。しかし、試料を レンズの内部に配置したインレンズ形では、 で、一次電子検出のはよりでなく、 で、一次電子検出のは、 で、二次電子検出の で、二次では、 で、二次では、 で、二次では、 で、この内部に配置できないという問題が生じる。

【尭明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、低加速領域で高分解能化を図り、かつ二次電子の高検出感度が得られる電子光 学系を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

低加速電圧で高分解館を得るためには、試料を レンズの内部に配置したインレンズ形でかつこの 試料に負の電圧を印加して一次電子線を設速させ

ここで、 $k=\sqrt{e/2\,m\,V_o}$, e/m:電子の電荷/質量である。

この時、検出すべき二次似子8のエネルギは紋速電圧 V_R でありかつ電子線2と方向が逆であるので、二次電子8の傾向角 θ は、

この偏向方向を検出器の方向と一致させておけば、 二次電子は検出器に向かって進むので、検出効率 の向上が図れることになる。

【実施例】

。 1917年1月1日 - 1977年 1978年 1978年 1978年 1977年 1978年 19

本発明の一実施例を第1図により説明する。

電子銃1からでた電子線2は、幾つかのレンズ (本実施例では加速レンズ3、コンデンサレンズ 4、対物レンズ5)により細く絞られて試料6上 を感射する。この電子線2は偏向器7により試料 6上で二次元的に走査される。また、試料6から でてきた二次電子8は、二次電子検出器9により 検出されて映像信号となる。 ここで、試料6は電子線2を減速するために負の電圧Vaが印加されている。このとき、出てきた二次電子はこの減速電圧Vaにより逆に加速され、検出数9の電界のみでは十分に検出数9の方に偏向できなくなる。

そこで、出てきた二次電子8を校出級9の方に 偏向するために偏向器を配置すればよいが、電子 線2の軌道に影響のないように電界Eと磁界Bと を直行させたいわゆるE×B形のフィルタ10を 対物レンズ5と校出額9との間に配置している。

このとき、(1) 式のようにEとBを印加すれば、電子線2の軌道には影響を与えずに二次電子8のみを検出器の方に偏向でき、検出効率の向上が図れる。

ただこの場合、フィルタ10による色収差が問 類になる。この色収差による偏向角βは、

 $\beta = \Delta V E L / 4 V_0^2$

 $= an \theta \Delta V V_R / 2 V_0^2 \left(I + \sqrt{V_R / V_0} \right) \dots (3)$ で表わされる。ここで、 ΔV は電子線 2 のエネルギ頓である。

く、二次電子8のみを検出器9の方に傾向することが可能となる。すなわち、低加速領域でも高分解能でかつ二次電子の高検出効率が得られることになる。

第1回に示す本発明を実施した結果のごく一例を以下に示す。フィルタ11を物点12とフィルタ10とのほぼ中間に配置して電界Eと磁界Bとの作用長を約20mmとなるように構成し、V。=1kVと固定にしてVa=0~900Vと変化させた。このとき、フィルタ10、11のそれぞれのEとBの強さをE=0~25V/mm,0~50V/mm,B=0~14ガウス(Gauss),0~28GeussとVaに連動させて変化させたところ、4~6mmの高分解能が実現できた。

本発明は、1 k V 以下の低加速電圧で n m オーダの分解能を得ることを目的になされたため、フィルタを2 段にしたが、目的によっては 1 度で観成しても二次電子の高検出効率化は可能であることは、本実施例で述べた通りである。

また、本実施例では試料がレンズの内部に配図

そこで、本発明では第4回ならびに第1回に示すように、E×B形のフィルタ11を配置してこの色収整を自己消去できるようにした。すなわち、第4回から分かるようにΔVのエネルギ位がりを持つ電子線2があたかも物点12の一点から出たかのようになるようにフィルタ11を動作させる。このフィルタ11の傾向角β・は、

 $\beta' = S \beta / T$ (4) $\xi \uparrow h i i \zeta h$.

以上により、電子線2の径を増大させることな

したが、レンズの外側に配置された構成の光学系にたいしても実施することができる。なおこの場合、二次電子検出器は試料と対物レンズとの間にあってもよいし、第1回のように対物レンズの上側にあってもよいことはいうまでもない。要は、試料と二次電子検出器との間にE×B形のフィルタがあれば実現できる。

さらに、本発明は走査形電子頭微鏡に対して述べたが、これに限ることなく類似の電子線応用装置一般に適用できるし、さらにイオン線のような荷電粒子線応用装置一般に適用できることは貸うまでもない。ただ、正の電荷を持っている荷電粒子線の場合には、該速電圧は正の鉱にする必要がある。

【発明の効果】

本税明によれば、低加速領域でも荷電粒子線程を増大させることなく二次荷電粒子を検出器の方に傷向することが可能となるので、高分解能でかつ二次荷電粒子の高検出効率が得られる効果がある。

4、 図面の簡単な説明

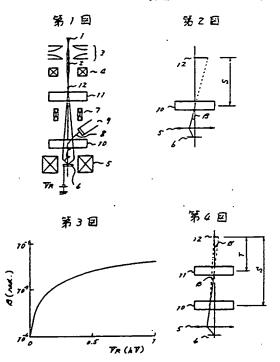
第1回は本発明の一実施例を示す荷電粒子光学 系の級断面図、第2回はE×B形フィルタの色収 差に関する説明図、第3回はE×B形フィルタの 色収差により生じる個向角と試料に印加した級速 電圧との関係曲線図、第4回はフィルタの色収差 を自己打消しさせるための基本光学系の級断面図、 第5回はE×B形フィルタによる一次電子線と二 次電子の軌道を示す説明図である。

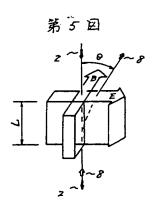
符号の説明

1: 世子鉄、2: 電子線、3:加速レンズ、4: コンデンサレンズ、5: 対物レンズ、6: 試料、7: 偏向路、8: 二次電子、9: 二次電子検出器、10、11: E×B形フィルタ、12: 物点

代理人 井理士 小川 辟男







्रात् । कार्यकार व्यवस्थातम् अत्रावनात्रेनम् सम्बद्धान्तम् सम्बद्धान्तम् । स्वतः वर्षान्तम् वर्षान्तम् वर्षान्